



一种双阀激光溅射反应源

文献类型: 专利

作者 唐紫超; 谢华; 刘志凌; 秦正波; 张世宇

发表日期 2014

专利国别 CN

专利号 CN201310468675.4

专利类型 发明

权利人 中国科学院大连化学物理研究所

是否PCT专利 否

中文摘要 一种双阀激光溅射反应源, 该装置结构由溅射激光, 脉冲阀a, 脉冲阀b, 样品靶, 反应通道以及喷嘴组成。该发明具有很强的通用性, 不仅可以产生难熔的金属团簇, 而且可以产生半导体甚至绝缘体的团簇。系统结构简单, 便于维护 and 操作。

公开日期 2014-02-05

申请日期 2013-10-09

语种 中文

专利申请号 CN201310468675.4

源URL [<http://159.226.238.44/handle/321008/120697>]

专题 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所

推荐引用方式 唐紫超, 谢华, 刘志凌, 等. 一种双阀激光溅射反应源. 一种双阀激光溅射反应源. CN201310468675.4. 2014-01-01.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [大连化学物理研究所](#)

浏览

90

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

